

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 19 年 8 月 2 日 (2007.8.2)

【公開番号】特開 2005-14611 (P2005-14611A)
 【公開日】平成 17 年 1 月 20 日 (2005.1.20)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-003
 【出願番号】特願 2004-185216 (P2004-185216)
 【国際特許分類】

B 4 1 M 5/00 (2006.01)

B 4 1 M 5/50 (2006.01)

B 4 1 M 5/52 (2006.01)

B 4 1 J 2/01 (2006.01)

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 6 月 15 日 (2007.6.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

少なくとも 1 面上にインキ - 受容層がコーティングされた支持体を含んでなり、該インキ - 受容層はサブミクロンシリカならびにホウ酸もしくはホウ酸塩を用いて硬膜されたビニルエステルモノマー単位及びエチレン性不飽和カチオン性モノマー単位を含んでなる少なくとも部分的に加水分解されたコポリマーを含有し、該エチレン性不飽和カチオン性モノマー単位が第 4 級アンモニウム塩又は第 4 級ホスホニウム塩であり、該第 4 級アンモニウム塩が N, N - ジアルケニル - N, N - ジアルキル - アンモニウム塩であることを特徴とするインキ - 受容材料。

【請求項 2】

サブミクロンシリカ粒子、ビニルエステルモノマー単位、エチレン性不飽和カチオン性モノマー単位を含んでなる少なくとも部分的に加水分解されたコポリマーならびにホウ酸もしくはホウ酸塩を含有する分散液で、少なくとも 1 面上において支持体をコーティングし、それによりホウ酸もしくはホウ酸塩で硬膜されたインキ - 受容層を形成する段階を含んでなり、該エチレン性不飽和カチオン性モノマー単位が第 4 級アンモニウム塩又は第 4 級ホスホニウム塩であり、該第 4 級アンモニウム塩が N, N - ジアルケニル - N, N - ジアルキル - アンモニウム塩であることを特徴とするインキ - 受容材料の製造法。